

マスクレスリソグラフィ技術

産業技術総合研究所、東京科学大学、物質・材料研究機構、北海道大学は、2021年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)」の一環として、『マスクレスリソグラフィ技術』と題して技術セミナーを2025年 2月28日(金)にハイブリッド開催いたします。マスクレスリソグラフィ技術の解説に加え、各機関の共用施設のマスクレスリソグラフィに関わる事例を紹介いたします。産学官いずれのご所属の方々の奮ってのご参加をお待ちしております。

◇講演

【日時】2025年2月28日(金)12:55~16:40

【オンサイト会場】産業技術総合研究所つくば中央2-12棟第6会議室

http://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/tsukuba/center/tsukuba_map_c.html

【オンライン】Microsoft Teamsによるウェビナー配信(参加申込者へ別途URLをお送りいたします。)

【定員】オンサイト:80名、オンライン:200名(先着順、参加登録をお願いします)

【セミナー案内/申し込み】<https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2024-3/>

【参加費】無料

【連絡先メールアドレス】tia-npf-school3@aist.go.jp

◇講演プログラム

12:55-13:00 はじめに

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設(NPF)

松本 壮平

13:00-13:40 大日本科研のマスクレス(Point Array方式)のご紹介

株式会社大日本科研 澤頭 尚志

13:40-14:20 マスクレス露光装置と応用例のご紹介

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社 齋藤 光徳

14:20-15:00 マスクレス露光装置 DLシリーズ の高スループット化

株式会社ナノシステムソリューションズ 杉村 忍

15:00-15:20 休憩

15:20-15:40 NIMSが提供するマスクレス露光装置

物質・材料研究機構 微細加工ユニット 渡辺 英一郎

15:40-16:00 EB露光装置とマスクレス露光装置のMix and Match

東京科学大学 梅本高明

16:00-16:20 レーザー描画装置を用いた二層レジスト露光とその応用

北海道大学 松尾保孝

16:20-16:40 マスクレス露光機 MLA150の公開について

産業技術総合研究所 ナノプロセッシング施設 郭 哲維

主催:産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設(NPF)

共催:物質・材料研究機構微細加工ユニット

共催:東京科学大学 科学技術創成研究院未来産業技術研究所

共催:北海道大学北海道大学電子科学研究所